First Hit

Generate Collection Print

L2: Entry 31 of 47 File: JPAB Jul 14, 1992

PUB-NO: JP404193977A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04193977 A TITLE: METHOD FOR ELECTROPLATING

PUBN-DATE: July 14, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OTA, HIROTOKU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP

APPL-NO: JP02324814

APPL-DATE: November 27, 1990

INT-CL (IPC): C25D 5/00; H05K 3/18

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the dispersion of plating thickness and to reduce operations in an adverse environment by using an insoluble electrode as the anode of a <u>plating</u> bath, and executing the replenishment of copper in an electrodialysis bath.

CONSTITUTION: As an insoluble anode electrode, a platinum electrode 3 is set. By a cation exchange resin membrane 6 and an anion exchange resin membrane 7, it is partitioned into three small chambers. A copper electrode 11 is set in an anode chamber 8, and a platinum electrode 12 is set in a cathode chamber 10. A plating soln. 2 is fed to an intermediate chamber 9 by a pump 18. Furthermore, this plating soln. 14 is fed to a plating bath 1 by a pump 19. The compsn. of the plating soln. is constituted of 200g/l sulfuric acid, 70g/l penta hydrate of copper sulfate and 60ppm chlorine. Moreover, the compsn. of a copper compound aq. soln. 13 in the anode chamber 8 is constituted of 200g/l penta hydrate of copper sulfate, and 40g/l aq. soln. of sodium hydroxide 15 is poured into the cathode chamber 10. The result plating with 2.0A/dm2 current density and 25µm plating thickness for 57min is very good.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

## ⑩日本国特許庁(JP)

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-193977

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月14日

C 25 D 5/00 H 05 K 3/18 6919-4K G 6736-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

**60発明の名称** 電気めつき方法

②特 願 平2-324814

②出 願 平2(1990)11月27日

@発明者 大田 広徳

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

**加出 願 人 日本電気株式会社** 

東京都港区芝5丁目7番1号

四代 理 人 弁理士 菅野 中

明 細 書

1. 発明の名称

電気めっき方法

2. 特許請求の範囲

(1) 不溶性の陽極電極を設置されためっき槽と、 陰イオン交換樹脂膜及び陽イオン交換樹脂膜を 用いて陰極室、中間室、陽極室の3つの小部屋に 仕切られ、前記陰極室及び前記陽極室にそれぞれ 電極を設けた電気透析槽とを有し、

前記めっき槽と前記電気透析槽の前記中間室と の間にめっき液の循環機構を設け、

前記めつき槽及び前記電気透析槽の前記中間室にめつき被を満たし、前記電気透析槽の前記記憶を満たし、前記電極に網イイより、の電性のでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をでは、対象をできませる。

記陰極室及び陽極室それぞれに設けた電極間に、 前記めっき槽で流した直流電流と同じ値の直流電 流を流して被めっき体に健気めっきすることを特

徴とする電気めっき方法。 発明の詳細な説明

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電気めっき方法に関し、特に印刷配線板の電気めっき方法に関する。

[従来の技術]

従来の印刷配線板の電気めっき方法は、第3回に示すように、めっき槽1に、例えば硫酸及び硫酸鋼を含むめっき被2を満たす。次に陽極電極として網ボール25、25′をアノードケース26。 26′に入れ、さらにこれらをアノードバック2 7、27′に入れ、めっき槽1に浸漬する。

次に、所望の箇所に穴あけを施し、無電解めつき処理を行った基板4をめっき治具に取り付け、めっき槽1に浸漬する。次に、網ボール25,25′を陽極、基板4を陰極として直流電流を流す。これによって網ボール25,25′より網イオン

がめっき液2中に溶解し、基板4に鋼が折出される。

## [発明が解決しようとする課題]

この従来の電気めっき方法では、陽極として網ボールを使用しているため、めっきを行うことにより網が溶解し、網ボールの表面積が徐々に小さくなるため、陽極の表面積を一定にすることが困難であり、めっき液の組成の変動や電流密度の分布が不均一になる。

また、銅ボールを補給するときに、めっき槽上 での硫酸雰囲気、高電流、重い銅ボールの運搬等 の環境、作業性が悪い。

本発明の目的は、めっき液の組成の変動や電流 密度の分布の不均一をなくし、悪影響下での作業 を減らす電気めっき方法を提供することにある。

## {課題を解決するための手段]

前記目的を達成するため、本発明に係る電気めっき方法においては、不溶性の陽極電極を設置されためっき槽と、

陰イオン交換樹脂膜及び陽イオン交換樹脂膜を

 $C u^{**} + 2 e^{-} \rightarrow C u^{*}$  ... (1)

陽極である不溶性電極側では、次の (2) 式の 反応が起こる。

 $H,O \rightarrow 2H^+ + \frac{1}{2}O$ 。  $\uparrow + 2e^- \cdots (2)$  次に、陸イオン交換樹脂膜及び陽イオン交換樹脂膜を用いて、陸極室、中間室、陽極室の3つの小部屋に仕切られた電気透析槽を設け、陽極室及

前記めっき槽と前記電気透析槽の前記中間室と の間にめっき液の循環機構を設け、

#### [作用]

めっき槽及び電気透析槽の中間室にめっき液を

び陰極室に電極を設置する。中間室にはめっき液 を満たし、陽極室には絹イオンを含む電解質溶液、 例えば硫酸絹水溶液を満たし、陰極室には電解質 溶液、例えば水酸化ナトリウム水溶液を満たす。

そして、両電極間に直流電流を流すと、陽極室 から中間室へ陽イオン交換樹脂膜を通って、銅イ オンが選択的に移動する。また、陰極室から中間 室へ陰イオン交換樹脂膜を通って、水酸イオンが 選択的に移動するが、めっき液中の水素イオンに よって中和される。

次に、前述しためっき槽と、この電気透析槽の中間室とを配管でつなぎ、めっき液を循環することにより、めっき槽内でめっき反応により消費される銅イオンを電気透析槽の中間室内で蓄積される銅イオンにより補なうことができる。

操極室を満たす個イオンを含む電解質溶液の網イオン濃度を高くすることにより、めっき液が満たされている中間室へ移動する陽イオンはほとんど銅イオンのみとなる。

従って、めっき槽で流す電流値と電気透析槽で

流す電流値を等しくしてやれば、めっきの折出で 消費した飼イオンの量と電気透析槽で中間室に移 動した銅イオンの量は等しくなるため、めっき液 中の銅濃度は常に一定である。

また、めっき槽と電気透析槽の電流値を等しくすることにより、めっき槽内の陽極で発生する水素イオンと、電気気が等モルで中間室から中間室からをで発生をある。従れて、のより、のから電気ののかっきをである。電気の分布が常に均一である電気めっきができる。

#### (実施例)

次に、本発明の実施例について図面を参照して 説明する。

#### (実施例1)

第1図は、本発明の実施例1を示す概略図である。

また、電気透析槽5の陽極室8に入れた網化合物水溶液13の組成は、硫酸網五水塩200g/ &であり、陰極室10には40g/&の水酸化ナトリウム水溶液15を入れる。

大に、所望の箇所に穴あけを施され、無電解網めっき処理を行った基板4をめっき治具に取り付け、めっき槽1中のめっき被2に浸漬する。陰極電洗密度を2.0 A / d m ' として、設定めっきを厚2.0 A / d m ' として、設定がったを厚2.0 A / d m ' として、設定がった。これと同時に、電気透析槽5の陽極室8内のの解極11と陰極室10内の白金電極12をリード線17で直流電源16に継ぎ、両電極間にめっき槽1で流した電流値と等しい電流値を流した。

めっき前後における硫酸濃度。網濃度を分析したところ、それぞれ200g/g。70g/Q(硫酸銅五水塩として)であり、めっき前後での変化は見られなかった。また、基板のめっき厚の分布を調べたところ、パラツキが小さく非常に良好であった。

## (実施例2)

図において、めっき槽1内に、不密性階極を整して、あっき槽2 を設置する。これを整理をある。これを登録される。これを登録される。これを登録される。これを登録される。これを登録を受ける。ののののでは、ないのではないのでは、ないのではないのでは、ないでは、ないでは、ないではないではないでは、ないでは、ないではないではないでは、ないではないではないではないではないではないではないではないではないでは

次に、めっき槽 1 及び電気透析槽 5 の中間室 9 にめっき被 2 、 1 4 を満たし、ポンプ 1 8 、 1 9 を動かし、めっき液 2 、 1 4 を循環させる。使用しためっき液 2 、 1 4 の組成は、硫酸 2 0 0 g / g , 硫酸銅五水塩 7 0 g / g , 塩素 6 0 p p m である。

第2図は、本発明の実施例2を示す概略図であ ス

実施例1では、網イオンの補給額として電気透析槽5の陽極室8内に設置した網電極11より電流を流すことにより網が溶解するが、実施例2では、電気透析槽5の陽極室8に設置する電極は白金電極24とし、網化合物水溶液23が入れてある網補充槽22を設け、ポンプ21を通して気気透析槽5の陽極室8に網を補給している。その他の装置の構成は実施例1と同じである。

めっき前後における硫酸濃度、銅濃度を分析したところ、両成分ともめっき前後での変化は見られず、また基板のめっき厚のバラツキも小さく、 非常に良好であった。

また、めっき条件を変更しても本発明の効果は 認められる。

## [発明の効果]

以上説明したように本発明は、めっき槽の陽極 に不溶性の電極を用い、銅の補充を電気透析槽で 行っているため、浴組成の変動がなく、めっき厚 のパラツキも小さく、また悪環境下での作業が減 少するという効果を有する。

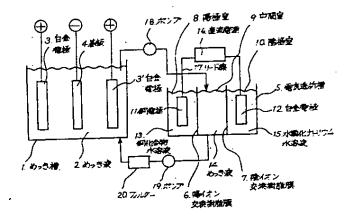
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図, 第2図は、本発明の実施例による電気 めっき方法を示す機略図、第3図は、従来の電気 めっき方法を示す概略図である。

- 1 … めっき槽
- 2; 14…めっき被
- 3, 3', 12, 24…白金電極 4…基板
- 5 … 似気透析槽
- 6 …隔イオン交換樹脂膜
- 7 … 陰イオン交換樹脂膜 8 … 陽極室
- 9 … 中間室
- 10…陰極室
- 1 1 … 網 25 極
- 13,23…鍋化合物水溶液
- 15…水酸化ナトリウム水溶液 16…直流電源
  - 18, 19, 21…ポンプ
- 1 7 …リード線 2 0 …フィルター
- 2.2 … 網 補 充 槽
- 25, 25′ …網ポール
- 26, 26' …アノードケース
- 27, 27' …アノードバック

特許出願人 日本電気株式会社

代理人 弁理士 菅 野



第 1 図

